



2013年11月4日号

目次

(W&B No. 201306CY)

1. 意匠特許改正に関する特許審査指南改正の意見募集(2013年11月22日まで)
2. 改正商標法のポイント(2)
3. 特許出願動向 2013年9月末の出願状況

【1】意匠特許改正による特許審査指南改正案<意見募集>2013年11月22日まで

知識産権局は10月22日付け、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を意匠特許により保護することを目的とした審査指南(審査基準)の改正案を発表し、即日一般からの意見募集を開始した。日本では、すでに平成19年4月の意匠法改正により、その機器の制御や設定等の操作に使用される画面デザインが保護の対象となっている。中国の現行特許法では、画面デザインを意匠特許の保護範囲外とする立場をとっているため、大きな方針転換を示したことになる。

中国でも電子情報技術の急速な進展に伴い、パソコン、デジタルカメラなどの電子機器や携帯電話や家電製品など広く使用されるようになり、その製品の市場での成否を決定する大きな要因になっている。従って、中国企業のGUI開発に対する投資やその保護に対する関心が高まっている。また、創作者のGUI分野における創作とイノベーションを効果的に奨励することで、電子情報製品の革新を促進し、企業の市場競争力を向上させるために、「特許審査指南」を改正し、GUIを意匠特許の保護対象とする必要があるとしている。

知識産権局は2013年3月に「特許審査指南」の改正作業に着手し、調査研究後、局内での意見を募り、今回の改正案が作成された。意見募集稿は保護範囲の例外、出願図面、図面の説明、意匠の構成要素、および類比判定にかかる規定に関する改正となっている。

1. 保護範囲の例外(第1部分第3章 7.4 節)

「意匠特許権を付与しない場合」には、特許法2条4項の規定に基づき、以下の項目は意匠特許権を付与しない状況に該当するとして、11項目が列挙されている。その11項目が下記のように修正された。

現行 「(11)製品に電気を入れて表示される図案。例えば、デジタル時計の表示装置に表示される図案、携帯電話の表示装置に表示された図案、ソフトウェアのインターフェースなど。」

改正案 「(11)人と機械の相互作用とは無関係、或いは製品の機能の実現とは無関係に製品の表示装置に表示される図案。例えば、電気のオンオフ時の人と機械の相互作用及び製品の機能の実現とは無関係な電子画面壁紙や画像、製品の機能の実現とは無関係のウェブサイトのレイアウトやゲームの画面。」

2. 出願図面(第1部分第3章 4.2 節)

「意匠の図面又は写真」の項目の平面図の説明部分に、下記が追加された。

「GUIを含む製品の意匠の場合、提出図面はGUIの位置を示した製品全体の意匠図面を含まなければならない。GUIが動作する図案である場合、出願人は少なくとも一つの状態を示す製品全体の意匠図面を提出する必要がある、その他の状態については重要なポイントとなるコマの図面のみを提出してもよいが、提出する図面は動作する図案における動く画像の変化する動作と一意に特定できなければならない。」

3. 図面の説明(第1部分第3章 4.3 節)

「図面の簡単な説明」の項は次のように説明が開始され、その7項目が追加された。

専利法第59条2項に、意匠権の保護範囲は、図面又は写真に示す当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、図面又は写真に示す当該製品の意匠の解釈に用いることができる、と定めている。専利法実施細則第28条によると、簡単な説明には次に掲げる内容を含めるものとする。(1から6は省略)

「(7)GUIを含む製品の意匠特許出願の場合、GUIの用途を明記しなければならず、必要に応じてGUIの設計について説明する。例えば、製品中のGUIの位置、相互作用方式から変化状態など。」

4. 意匠の構成要素(第1部分第3章 7.2 節)

「製品の形状、図案又はその組合せ、並びに色彩と形状、図案との組合せ」の項は、次のように説明が始まり、最後の削除線部分が削除された。

意匠を構成するのは製品の意匠要素又は要素の組合せである。その中に形状、図案又はそれらの組合せ、並びに色彩と形状、図案との組合せが含まれる。

「図案とは、線、文字、符号、色の配列や組合せにより、製品の表面に構成された図形を言う。図案は、製図又はその他の創作者の図案設計の構想を具現する手段により制作されても良い。~~製品の図案は、固定され、可視でなければならない。その時々に見えない、或いは特定な条件に限って見えるものであってはならない。~~」

5. 類比判断(第4部分第5章 6.1 節)

「同一又は類似する種類の製品における従来意匠との比較」の項は、次のように説明があり、5項目が追加された。

係争意匠の種別が同一又は類似する製品の従来意匠と比べて明らかな相違があるか否かを確定する場合一般的に、以下に挙げる要素も統合的に考慮すべきである。

「(5)GUIを含む製品の意匠の場合、登録意匠のそれ以外の意匠設計が慣用設計である場合、そのGUIは全体の視覚効果に対して、より顕著な影響がある。」

これは、工業製品の意匠は数多くの要素から構成されているため、例えば、携帯電話の場合、携帯電話機の本体の形状、色彩、配置及び模様について多用な開発が可能である一方、画面のGUIについて多用なデザインをすることもできる。この場合、GUIは全体の視覚効果に対して、より顕著な影響があるといえる。

改正案の詳細は、下記のサイトをご参照ください。

http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201310/t20131021_822758.html

【2】改正商標法のポイント(2)

2014年5月から施行予定の改正商標法のポイントを数回に分けて紹介する。現在、商標法実施細則の改正が進んでいるため、現在入手できた資料で問題点や課題を説明する。今回は、その2回目で異議申立に関するポイントをご紹介する。

従来の商標登録異議申立手続きは、行政2審に司法2審の合計4審による終審を採用していたため、商標出願の権利確定手続きが煩雑で、かつ権利確定まで長期間を要したため、利用者には負担となり、事業活動での支障も生じた。また、不法な経営者の一部には「悪意をもった異議申立」をすることで、競合会社の迅速な商標登録を妨害し、長期間にわたり商標の権利化ができず不安定な状態になることも生じている。こうしたことから、異議申立の30%程度しか成功していないとの認識がある。今回の改正は、商標登録の異議申立制度を簡素化し、再構築している。

(3) 異議申立手続き

- ① 法定理由と申立人の区別：異議申立法定理由の法定理由を絶対的事由と相対的理由に区分し、異議申立人権利主体も絶対的事由と相対的事由で、商標異議申立の権利を有する主体を区別することで、異議申立手続きの濫用問題を解決する。(第33条)

相対的理由の申立人となりうる先行権利者とは商標権者以外の先の権利者であり、著作権者、商号権者や意匠特許権者などが対象となる。一方、利害関係人は商標審査審理基準からは商標権者或いは実施権者であるが、民事訴訟法からその他の利害関係人も考えられるので、運用で判断する必要がある。なお、先登録での無効を主張する場合は自らが商標権者であることが求められる。

法定理由	違反对象条項	申立人
絶対的事由	第10条(使用禁止対象商標) 第11条(非登録対象商標) 第12条(立体商標の非登録対象)	何人も可能
相対的理由	第13条第2項と第3項(未登録馳名商標) 第15条(冒認商標出願) 第16条第1項(誤認させる地理的標識) 第30条(先登録) 第31条(同日出願) 第32条(他人の先の権利)	先行権利者 利害関係人

- ② 異議申立の法定審査期間の導入：公告期間の満了日から起算して12カ月以内に登録を決定するかどうかを異議申立人と被異議申立人に書面で通知する。これには当事者が補正や追加説明などする期間、追加の証拠調べや証拠の提出などの期間は含まれない。なお、商標局が特殊事情により延長日が必要に応じて、国务院工商行政管理部門の承認を経て、6か月延長することができる。(第35条)
- ③ 再審請求の廃止：商標局が登録許可を決定した場合、商標登録証を発行し、公告する。異議申立人が不服の場合、不服審判を申立てることはできず、別途、商標評議審査委員会に当該登録商標の無効を別途申し立てることになる。

異議申立が認められた場合、商標出願人は評審委員会に再審(復審)を請求することができる。再審は12カ月以内に決定されなければならない。必要に応じて、国务院工商行政管理部门の承認を経て、6か月延長することができる。評審の決定に不服の場合、裁判所に提訴することができる。(第35条)

- ④ 分割出願:商標出願の一部の指定商品のみ或いは一部の区分のみを対象に異議申立が請求された場合、商標出願人は異議申立の副本を受領後、商標局に異議申立部分を除き、分割商標出願を提出し、異議申立がされていない商品や区分を別出願として、分割することができる。これは、出願日を繰り下げずに認可された権利範囲を先に登録できるメリットがある。

次回は、無効手続きは次号で解説予定。

【3】特許出願動向 2013年9月末の出願状況

2013年9月末までの国家知識産権局が受理した特許出願は161.1万件(15%増)、特許登録は101.6万件(14%増)である。昨年同期が29%増であったことと比べて発明特許出願の増加率はほぼ同レベルであるが、意匠の伸びが横ばい、外国からの出願が減少していることが注目される。外国からの出願は実用新案を除き、減少している。特に、日本からの発明特許出願は、31,138件と前期同期比 Δ 2.6%と減少していることは注目される。韓国からの発明特許出願は22.9%増加して7,659件と、注目する必要がある。実用新案の出願は引き続き増加している。

2012年の特許登録は14%増加したが、発明特許は横ばい、意匠は10%減少し、実用新案の40%増加が引き続き目立っている。外国からの特許出願では、発明特許が19%減少していることは注目される。

PCT出願受理は15,963件と前期比15%と伸びている。なお、PCT出願の中国発明特許移行出願は54,154件と前期比4.5%増、実用新案特許での移行出願は516件と前期比31%増加している。

(1) 特許出願全体

出願	2012年	2013年	伸び率
発明	423,171	519,522	1.23
実案	506,797	620,639	1.22
意匠	469,073	471,516	1.005
合計	1,399,041	1,611,677	1.15

(2) 外国からの特許出願

出願	2012年	2013年	伸び率
発明	96,343	89,505	-0.07
実案	4,826	5,228	1.08
意匠	12,721	11,370	-0.10
合計	113,890	106,103	-0.06

(3) 特許登録全体

出願	2012年	2013年	伸び率
発明	164,270	163,610	-0.004
実案	389,241	543,606	1.40
意匠	340,849	309,616	-0.09
合計	894,360	1,016,832	1.14

(4) 外国からの特許出願登録

出願	2012年	2013年	伸び率
発明	62,498	50,506	-0.19
実案	3,341	5,131	1.53
意匠	11,525	10,646	-0.07
合計	77,364	66,283	-0.14

*** 記事に対するご質問や各種お問合せは、お気軽に下記までご連絡ください。■**